

Способ получения магнитооптических структур, включающий жидкофазное осаждение висмутсодержащей эпитаксиальной пленки из переохлажденного раствора-расплава на подложку из кальций-ниобий-галлиевого граната, отличающийся тем, что предварительно на подложку напыляют слой кремния толщиной 0,1-0,2 мкм с последующим отжигом ее при температуре 900-910°С в течение 5-6 часов.